



光設計研究グループ 第43回研究会

「微細光学素子技術」

【日時】2009年12月11日(金) 11:00~17:00

【場所】板橋区立文化会館 大会議室 東京都板橋区大山東町51-1

・都営三田線 板橋区役所前駅 徒歩7分程度

・東武東上線 大山駅 徒歩3分程度

交通の詳細→http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/002/002279.html

【ご案内】近年、微細加工技術の進歩により、光の波長以下の構造を有するような光学素子が登場してきています。このような素子は、従来では考えられなかった光学特性を有しており、高性能な反射防止膜、偏光素子、フォトニック結晶、波長選択的な光学特性制御など、様々な光学系への応用も期待されます。本研究会では、この分野の研究開発に携わる先生方にお話をいただき、皆様の交流を深め合う場にしたいと考えております。

プログラム

11:00	開会の挨拶	
11:10	1. ナノ構造を金型で作る	○西井 準治 氏 (北海道大学)
11:50	2. サブ波長構造による高性能反射防止膜	○奥野 文晴 氏 (キヤノン(株))
12:30	昼食休憩	
13:30	3. ナノメートルサイズの微細加工技術と装置の開発	○栗原 一真 氏 (産業技術総合研究所)
14:10	4. 表面微細周期構造による熱放射制御に関する研究	○湯上 浩雄 氏 (東北大学)
14:50	休憩	
15:10	5. Blu-ray Disc Mastering技術を応用したサブ波長構造反射防止光学素子	○林部 和弥 氏 (ソニー(株))
15:50	6. フッ化物ナノ粒子を用いた高性能反射防止膜の開発および実用化	○村田 剛 氏 ((株)ニコン)
16:30	閉会の挨拶	
17:00	懇親会(無料です。ぜひご参加ください)	
※講演の順番は変わるかもしれないことを予めご了承ください		
※一部の講演題目はタイトルが仮題です		

【主催】日本光学会(応用物理学会)光設計研究グループ(代表:植田 博文(オリンパス))

【共催】板橋区

【参加費】光設計研究グループ会員:4,000円、光設計研究グループ学生会員:無料
板橋区民・板橋区企業:7,000円、一般:10,000円、学生一般:2,000円
当日、受け付けにてお支払い下さい。

【定員】100名(定員になり次第締め切ります。定員オーバー後の申込みはその旨ご連絡致します。)

【参加申込】下記申込書の内容をE-mailまたはFAXまたは郵送にて下記申込先にお送り下さい。

【申込先】パナソニック(株)技術統括センター AVCデバイス第一開発グループ 市橋 宏基
〒571-8504 大阪府門真市松生町1-15

TEL:050-3487-5024 FAX:06-6906-1974 E-mail: k43reg@opticsdesign.gr.jp

【問合せ先】サイバネットシステム(株)応用システム事業部 CODEV技術グループ 秋山 健志
〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3番地 富士ソフトビル

TEL:03-5297-3424 FAX:03-5297-3646 E-mail: k43@opticsdesign.gr.jp

【ホームページ】<http://www.opticsdesign.gr.jp/>

パナソニック(株)技術統括センター AVCデバイス第一開発グループ 市橋 宏基 行

光設計研究グループ 第43回研究会 申込書

氏名(フリガナ)	
所属	
住所 TEL、FAX E-mail	
参加区分(○印)	1. 光設計研究グループ会員 2. 学生会員 3. 板橋区民/区内企業 4. 一般 5. 学生一般
懇親会(○印)	1. 参加、 2. 不参加 (懇親会は参加無料です)
アンケート(一般・学生一般) 本研究会をどこで知りましたか?	1. WEB 2. メール 3. ビラ 4. 雑誌() 5. 会社・学校 6. その他()